

2006年9月15日

日中特許法シンポジウム結果概要

国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）

1. 実施概要

日 時：2006年9月7日（木）14：00～18：00

場 所：虎ノ門パストラル

主 催：国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）

共 催：日本国特許庁、中華人民共和国国家知識産権局

事務局：ジェットロ

主要参加者：

日本側	宗国 旨英	国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）座長
	塚本 弘	ジェットロ副理事長
	中嶋 誠	特許庁長官 他
中国側	尹 新天	国家知識産権局 条約法規司長
	王 永昌	最高人民法院 民事第三庭（知識産権庭）処長
	姜 丹明	国家知識産権局 条約法規司 条法一处 処長
	楊 紅菊	国家知識産権局 条約法規司 条法三处 副処長 他

概 要：

訪日団団長である尹 新天 国家知識産権局 条約法規司長が「中国専利法意見募集稿に対する説明」と題し法改正の主たる内容を基調講演し、続いて以下の内容で、日中の有識者によるパネルディスカッションを実施した（メンバーリストは別紙参照）。

- ・ 意匠分野の改正（世界公知公用、創作非容易性 等）
- ・ 専利権侵害判断の基準（侵害の定義、均等論、禁反言、公知技術の抗弁 等）
- ・ 専利行政法執行問題（行政取締り等によるエンフォースメント強化 等）

パネルディスカッションでは極めて友好的な雰囲気で行進。日中双方ともに知的財産制度の改善に向けて熱意を持って建設的に議論。日本側は、一部の改正内容について問題点を指摘し、追加的な改正も要請。中国側は、日本側の問題指摘を十分に理解。指摘を踏まえて国内にて更なる検討を行うことを約束。

2. 経緯と背景

- ・ 本年6月の「知的財産保護官民合同訪中代表団」に対し、中国側より、専利法（日本の特許法、意匠法に相当）の改正に関する日本政府及び産業界との意見交換が提案された。
- ・ 訪日団派遣の趣旨の一つは、知財保護重視への政策転換の対外的なアピー

ル。(訪日団派遣は、呉儀副総理の強い指示に基づくもの)

- 第11次5ヶ年計画で「自主開発型企業の育成のための知財保護強化」を国家方針に設定。
- 本年内の公表を目処に「国家知財戦略」を策定中。全国50箇所の知財侵害通報センター設置。
- 専利法改正案の第1条に、その目的として「革新型国家の建設」を明示。

3. 結果総括

約300名の知財関係者が参加し関心の高さが伺えると共に、準備段階から日中双方が緊密に連携していたことなど、総じて非常に意義のあるシンポジウムとなったと思われる。

法改正の初期段階で中国側のスタンスを政府のみならず、シンポジウムという形で広く国民に対して周知する機会を実現させたことは画期的と評価できる。これは、知的財産保護官民合同訪中代表団が今年で4回目を迎え、第3回から交渉の基本的スタンスを「協力と要請」に変更したことなどに基づいていると思われる。

シンポジウムに先立ち9月4日から7日の日程で開催した意見交換会¹において、中国側が再検討を約束した事項について、シンポジウム当日に言及するなど、今次法改正による知財制度の改善に強い意欲を示した。

満足度調査結果

総合評価：4段階中上位2項目98%

4. 今後の対応

中国側発言につき関係省庁、産業界などと連携し、中国側の今後の動向を注視するとともに、専利法改正案パブコメ募集に対して官民で意見提出を行う。

今回のシンポジウムの内容を日本の産業界にフィードバックし、今後実施される日中知財関係の協力事業の一助ともする。 以上

¹意見交換(9月4日~7日 於:特許庁)

- ・ 専利法改正案の20以上の項目につき、3日半にわたり日中間で意見交換
日本側 特許庁 野澤総務部長、小林国際課長、瓜本意匠課長、木原技術調査課長
経済産業省 松林大臣官房参事官(模倣品対策・通商担当)
産業界主要各社・団体の知財関係者、他
中国側 尹 新天 国家知識産権局 条約法規司長(調査団長)
王 永昌 最高人民法院 民事第三庭(知識産権庭) 処長、
王 清 全人代常務委員会 法制工作委員会 経済法室第三処長、
黄 文軍 國務院法制弁公室 教科文衛法制司主任科員、他